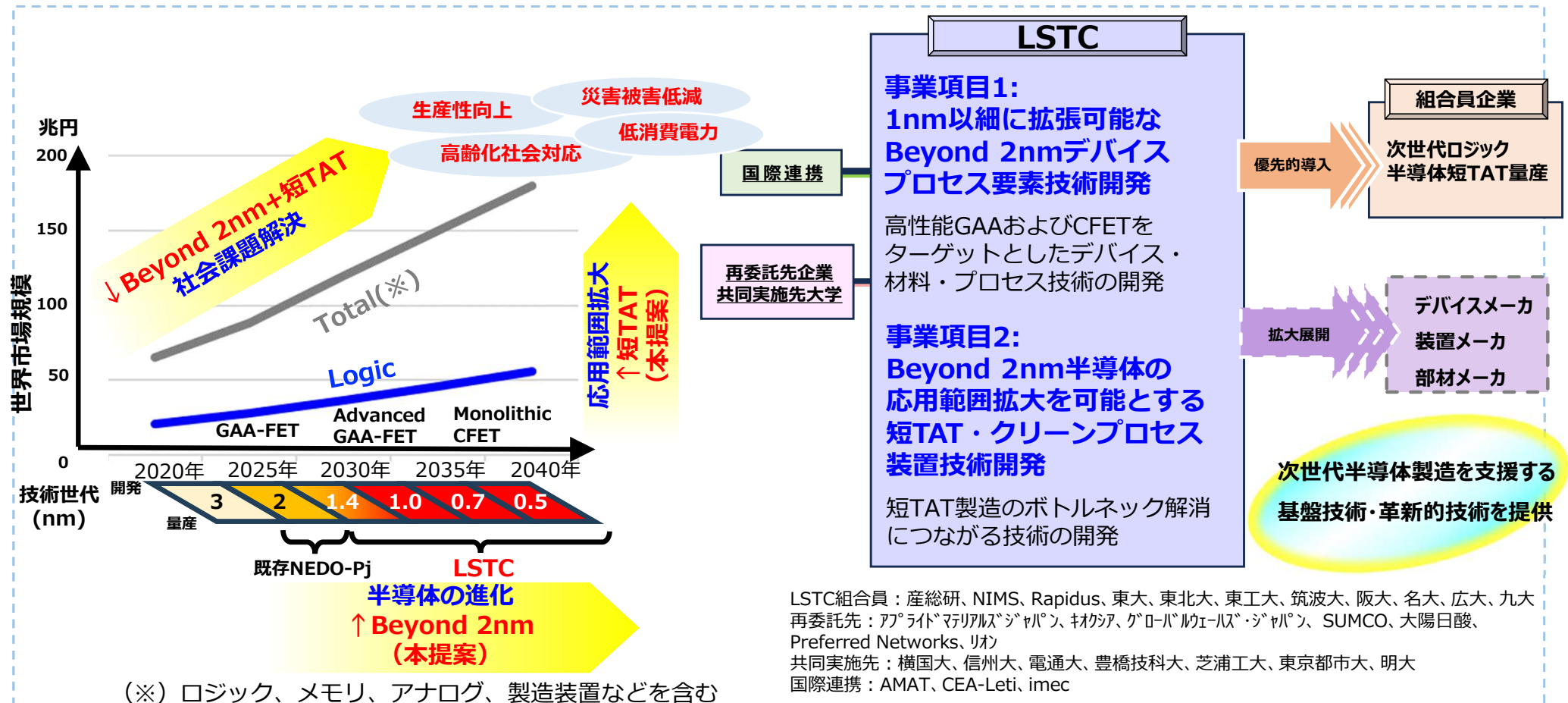


Beyond 2nm及び短TAT半導体製造に向けた技術開発

実施者	技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）
概要	2nm世代よりもさらに高性能な半導体(Beyond 2nm)実現に向けた革新的技術として、Beyond 2nm向けデバイス・材料・プロセス要素技術および短TAT・クリーンプロセス装置技術を開発する。当該技術の開発により、半導体の高性能化のみならず、長期化する半導体製造期間の短縮および早期な製品の市場投入を可能とし、我が国の半導体製造の競争力強化および半導体市場シェア挽回に大きく寄与する。半導体の更なる進化によるAI性能の飛躍的な向上と、短TAT化で、より多くの社会的ニーズへの対応を可能にし、社会課題解決とDX化推進に貢献する。



LSTC組合員：産総研、NIMS、Rapidus、東大、東北大、東工大、筑波大、阪大、名大、広大、九大
再委託先：アソシエイト・マテリアル・ジャパン、キオクシア、グローバルウェル・ジャパン、SUMCO、太陽日酸、Preferred Networks、リウ
共同実施先：横国大、信州大、電通大、豊橋技科大、芝浦工大、東京都市大、明大
国際連携：AMAT、CEA-Leti、imec